

傾斜回転式プラズマ強化化学気相成長（Pecvd）装置 管状炉

商品番号: KT-PED



前書き

PECVDコーティング装置でコーティングプロセスをアップグレードしましょう。LED、パワー半導体、MEMSなどに最適です。低温で高品質な固体膜を堆積します。

[詳細を学ぶ](#)

サンプルホルダー	サイズ	1～6インチ
サンプルホルダー	回転速度	0～20rpm 調節可能
サンプルホルダー	加熱温度	≤800℃
サンプルホルダー	制御精度	±0.5℃ 島電（SHIMADEN）PIDコントローラ
ガスページ	流量計	マスフローコントローラ（MFC）
ガスページ	チャンネル	4チャンネル
ガスページ	冷却方法	循環水冷却
真空チャンバー	チャンバーサイズ	Φ500mm X 550mm
真空チャンバー	観察ポート	バッフル付きフルビューポート
真空チャンバー	チャンバー材質	316ステンレス鋼
真空チャンバー	ドアタイプ	前面開放型ドア
真空チャンバー	キャップ材質	304ステンレス鋼
真空チャンバー	真空ポンプポート	CF200フランジ
真空チャンバー	ガス入口ポート	φ6 VCRコネクタ
プラズマ電源	ソース電源	DC電源またはRF電源
プラズマ電源	結合モード	誘導結合またはプレート容量結合
プラズマ電源	出力電力	500W～1000W
プラズマ電源	バイアス電力	500v
真空ポンプ	補助ポンプ	15L/S ロータリー真空ポンプ
真空ポンプ	ターボポンプポート	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
真空ポンプ	リリーフポート	KF25
真空ポンプ	排気速度	ロータリーポンプ: 15L/s、ターボポンプ: 1200l/sまたは1600l/s
真空ポンプ	真空度	≤5×10-5Pa

真空ポンプ	真空センサ	電離/抵抗真空計/フィルムゲージ
システム	電源	AC 220V / 380V 50Hz
システム	定格電力	5kW
システム	寸法	900mm X 820mm X 870mm
システム	重量	200kg